採購規格需求書

採購案名(中文): 高光譜干涉分析顯微系統

一、採購項目與規格

- (一)名稱:高光譜干涉分析正立反射式顯微系統1套
 - 1.配件及功能
 - (1)六孔物鏡鼻輪,為編碼式設計,可將物鏡位置資訊傳送至 電腦系統。
 - (2)反射式 12V100W 鹵素照明,可切換為含 IR 波段輸出。
 - (3) 高解析 EC Epiplan 物鏡一顆,放大倍率為 10x,NA 值需達 0.25。
 - (4)高解析 EC Epiplan-Neofluar 物鏡一顆,放大倍率為 50x, NA 值需達 0.8。
 - (5)專用三眼式目鏡筒,分光比例為 100% 將光學影像傳輸至 相機接口或目鏡處。60N-C,1倍相機轉接環。
 - (6)四孔濾片轉盤,為編碼式設計,可將濾片位置資訊傳送至 電腦系統。
 - (7)10x 專用目鏡,視野數為 23mm, 2 顆。
 - (8)XY 電動載物台含控制桿,移動行程須達 75mm x 50mm 以上,承載表面需達 292mm x 187mm 以上。
 - (9)高光譜影像處理系統:
 - ·採用 CMOS 感測器,有效畫素至少需達 1280 x 1024。
 - ·光譜範圍:400-1700 奈米
 - ·光譜頻段數:∞*
 - ·可調整光譜解析度:

≦1.5 奈米@400 奈米

≦20 奈米@1700 奈米

·位元數: ≥12 位元

·視場角: ≥8度

·工作距離: ≥1 公尺至無限遠

·C型轉接環

- ·高光譜影像處理軟體
- ·須採用傅立葉轉換光譜技術,以確保高光通量與高靈敏度 之量測性能。
- ·系統應具備產生兩東相位鎖定之入射光複本能力,其相位 準確度須優於 1 阿秒 (1 attosecond)。
- ·干涉儀結構應採用超穩定雙折射設計,對外部震動具高抗 擾性,確保長時間量測穩定性。

2. 驗收條件

- (1) 軟體與電腦連線確認
- (2) 出廠報告確認
- (3) 軟體功能測試
- (4) 不移動樣品或載台情況下量測樣品能正常運作

(二)高光譜干涉分析專用顯微系統1套

1.配件及功能

- (1) UIS2 無限遠光學補正系統,內建凱勒照明,物鏡至成像 鏡無限遠平行光束,物鏡共焦距離為≦45mm。
- (2) LED 穿透光源,消耗功率 2.4W、前置型燈源調節器、內 建電線收納裝置。
- (3) 左右兩側可調節之同軸粗細調節輪,垂直行程≥15mm, 精細調焦旋鈕每刻度的移動距離:≦2.5μm,內建防撞片 裝置。
- (4) 內傾式省力型五孔旋轉鼻輪,並配備物鏡防塵蓋,減少光 路上粉塵之干擾。
- (5) 低平式載物台,隱藏式 X 軸向軌道線軌式,右手低位控制桿,手腕可平貼於桌面,使用行程 52mmX76mm,可替換樣本固定夾,省力橡膠套。
- (6) 三眼觀察筒,仰角30度,三段式分光模式。
- (7) 物鏡: 5X N.A.≥0.15, W.D.≥20.0mm; 10X N.A.≥0.30, W.D.≥11.0mm; 20X N.A.≥0.45, W.D.≥3.1mm; 40X N.A.≥0.75, W.D.≥0.63mm
- (8) 目鏡:10X廣角目鏡,配備橡膠材質目鏡避光罩,提升觀察效果。

- (9) Abbe 整合型轉盤聚光鏡, N.A 1.1, 鏡頭高對比塗佈設計, 適用於明暗視野、相位差觀察法。
- (10) 0.5X 影像轉接鏡組,須與顯微鏡同一光路系統,確保觀察效果。
- (11) 高光譜影像處理系統:
 - ·採用 CMOS 感測器,有效畫素至少需達 1280 x 1024。
 - ・光譜範圍:400-1000 奈米
 - ·光譜頻段數:∞*
 - ·可調整光譜解析度:

≦1.5 奈米@400 奈米

≦10 奈米@1700 奈米

- ・位元數: ≧12 位元
- ·視場角: ≧8 度
- ·工作距離: ≥1 公尺至無限遠
- ·C型轉接環
- ·高光譜影像處理軟體
- ·高光譜專用三腳架
- ·須採用傅立葉轉換光譜技術,以確保高光通量與高靈 敏度之量測性能。
- ·系統應具備產生兩東相位鎖定之入射光複本能力,其 相位準確度須優於 1 阿秒 (1 attosecond)。
- ·干涉儀結構應採用超穩定雙折射設計,對外部震動具 高抗擾性,確保長時間量測穩定性。

2. 驗收條件

- (1) 軟體與電腦連線確認
- (2) 出廠報告確認
- (3) 軟體功能測試
- (4) 不移動樣品或載台情況下,量測樣品能正常運作